

## بررسی مقاومت پوشش‌های رزین پایه معدنی مورد استفاده به منظور تثبیت نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم

### جهت حذف آلاینده‌های آلی از پساب صنایع رنگ و پوشش

علی ملکی<sup>۱\*</sup>، سید مسعود هاشمی<sup>۲</sup>

۱ دانشیار، آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیزورها و سنتز آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

۲ دانشجوی دکتری، آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیزورها و سنتز آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران



تاریخ دریافت:

۹۷/۰۹/۱۷

تاریخ پذیرش:

۹۷/۱۲/۰۹

چکیده

در این تحقیق مقاومت پوشش‌های رزین معدنی بمنظور تثبیت نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم جهت حذف آلاینده‌های آلی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا رزین پایه معدنی بر روی صفحه شیشه‌ای راکتور، پوشش داده شد، سپس عمل آماده‌سازی سطح رزین بوسیله یک حلال مناسب، بمنظور پوشش‌دهی (تثبیت) نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم صورت گرفت. در این تحقیق از حلال‌های مختلفی برای آماده‌سازی رزین استفاده شد. همچنین مدت زمان اقامت حلال‌ها جهت آماده‌سازی سطح پلیمر (رزین) مورد بررسی قرار گرفت. در آماده‌سازی سطح رزین استفاده از حلال یکی از موثرترین، سریع‌ترین و مقرون به‌صرفه‌ترین روش‌ها است، زیرا برای انجام عمل آماده‌سازی به دما، تجهیزات و دستگاه خاصی نیاز نیست. در این فرآیند زمان بهینه تماس میان حلال و سطح رزین پایه معدنی بمنظور آماده‌سازی سطح ۲۰ دقیقه ارزیابی شد. با توجه به نتایج حاصل از فرآیند آماده‌سازی سطح و آزمایشات مختلف همچون مقاومت در برابر آب، تست سختی سنج و DSC و تصاویر SEM بر روی پوشش‌های اعمال شده می‌توان چنین استنباط کرد که سطح رزین آماده‌سازی شده در برابر عوامل مورد آزمایش مقاومت خوبی را از خود نشان می‌دهد. برای بررسی تأثیر رنگبری و معدنی شدن رنگزا توسط نانوذرات  $TiO_2$  پوشش داده شده بر روی رزین، محلول رنگزا را داخل راکتور تصفیه پساب ریخته و عمل رنگبری در مدت زمان‌های ۳۰، ۴۵، ۶۰ و ۹۰ دقیقه صورت می‌پذیرد، در این زمان‌ها از محلول نمونه‌گیری کرده و توسط دستگاه UV/Vis طیف جذبی این نمونه‌ها گرفته می‌شود. در نهایت با مقایسه طیف محلول رنگزا قبل از فرآیند رنگبری و بعد از فرآیند رنگبری مشاهده می‌شود که عمل رنگبری و معدنی نمودن، بخوبی انجام شده است. در این تحقیق استفاده از رزین به عنوان چسب جهت نگهداری و تثبیت نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم باعث می‌شود که از اتلاف کاتالیست جلوگیری شده و هزینه‌های تصفیه پساب به میزان زیادی کاهش یابد.

مقاومت پوشش‌ها، پوشش‌دهی، نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم

، رزین معدنی، آماده‌سازی سطح

واژگان کلیدی

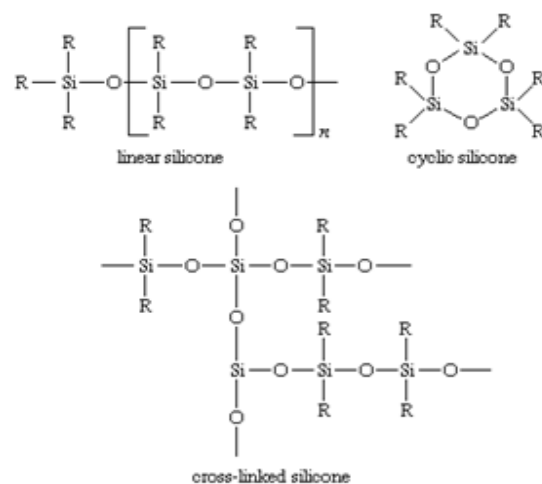
## ۱) مقدمه

در جهان امروز با گسترش فعالیت‌های صنعتی، ورود پساب‌های رنگی و غیر رنگی صنایع مختلف رنگ و پوشش مانند صنایع رنگ، خودروسازی، نساجی، آبکاری، پلاستیک، آرایشی-بهداشتی و غیره، خسارت‌های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می‌شود [۱-۴]. زیرا سمی بودن برخی از رنگ‌ها فقط سبب آسیب دیدن مناظر زیبای طبیعی نمی‌شوند بلکه به اکوسیستم‌های آبی نیز ضرر می‌رسانند [۲و۱]. برای مثال از نفوذ نور به داخل آب جلوگیری کرده و باعث مختل شدن فرآیند فتوسنتز می‌گردند [۴]. بنابراین در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی برای تصفیه و حذف آلاینده‌های ناشی از پساب صنایع مختلف صورت پذیرفته است [۵].

فرآیند اکسیداسیون پیشرفته (AOP) یکی از جدیدترین و کارآمدترین روش‌های تصفیه پساب می‌باشد که از آن برای تصفیه آلاینده‌های آلی می‌توان استفاده نمود [۶و۵]. از مزایای این روش نسبت به سایر روش‌ها می‌توان به حذف آلاینده‌های کامل ترکیبات آلی و معدنی نمودن آن‌ها (تبدیل ترکیبات آلاینده به ترکیبات معدنی بی‌خطر همچون آب، دی‌اکسید کربن و بعضاً مقدار کمی اسید معدنی بی‌خطر)، نداشتن معضل پسماند و انجام فرآیند در دما و فشار محیط اشاره نمود [۶-۸].

در این تحقیق برای بررسی مقاومت پوشش‌های آماده سازی شده (با استفاده از رزین معدنی) جهت تثبیت نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم، از آنالیزهای مقاومت در برابر آب، DSC و SEM استفاده شده است. برای این منظور از یک رزین معدنی به عنوان پوشش (چسب) جهت ایجاد اتصال میان دیواره راکتور و ذرات نانوقتوکاتالیست دی‌اکسیدتیتانیوم به منظور اتصال نانوذرات کاتالیست بر روی دیواره راکتور رنگبری پساب‌های رنگی استفاده گردیده است که از جمله مزایای استفاده از رزین معدنی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود [۹-۱۱]:

– قابلیت پوشش بر روی سطوح مختلف و فعالیت مناسب سطح جهت آماده‌سازی،



شکل ۱: چند نمونه از انواع رزین پایه معدنی مورد استفاده

– مقاومت در برابر آب و عوامل شیمیایی،

– مقاومت در برابر نور UV،

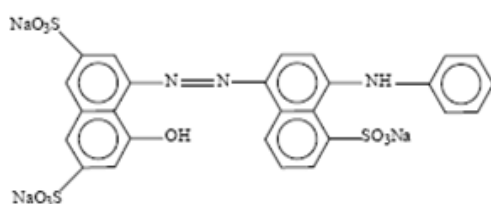
– پایداری مکانیکی، بی‌اثری شیمیایی و غیره.

از نکات مثبت استفاده از رزین برای پوشش نانو ذرات  $TiO_2$  می‌توان به توانایی آن در پوشش‌دهی سطوح غیرشیشه‌ای، عدم نیاز به صافی‌های نانویی جهت حذف نانوذرات  $TiO_2$  جدا شده از سطح و یا پراکنده در سیال و همچنین دوام بیشتر آن بر روی دیواره اشاره نمود که این نکات سبب کاهش قابل ملاحظه‌ای در هزینه ساخت و استفاده از این راکتورها و ایجاد حداکثر حفاظت در برابر اشعه فرابنفش، با استفاده از دیواره‌های غیرشیشه‌ای، می‌گردد.

## ۲) فعالیت‌های تجربی

به‌طور کلی مواد و ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارت از رزین معدنی (Ciba)، دی‌اکسیدتیتانیوم (Degussa)، اسید کلریدریک (Merck)، میکروسکوپ الکترونی نوری (SEM) مدل LEO 7455 vp و دستگاه DSC مدل Perkin Elmer-pyris ۶ هستند.

در این تحقیق برای بررسی مقاومت پوشش‌های رزین معدنی ابتدا رزین معدنی بر روی صفحات شیشه‌ای پوشش داده شد. پس از فرآیند آماده‌سازی بوسیله حلال بر روی سطح رزین‌های پوششی، نانو ذرات  $TiO_2$  مورد استفاده در فرآیند اکسیداسیون پیشرفته، جهت حذف آلاینده‌های رنگی، تثبیت می‌گردد. بدین منظور برای انجام این تحقیق ابتدا سطح راکتور (صفحات شیشه‌ای)، توسط محلول رقیق اسید کلریدریک (HCl) آماده‌سازی شد، سپس رزین معدنی بر روی سطح داخلی دیواره راکتور (صفحات شیشه‌ای) پوشش داده شد. هنگامی که رزین‌های پوشش داده شده کاملاً خشک گردید (که معمولاً زمان خشک شدن ۴۸ ساعت به طول می‌انجامد)، عمل آماده‌سازی سطح توسط حلال‌های مختلف بر روی رزین‌های پوشش داده شده در مدت زمان‌های ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ دقیقه به منظور پوشش‌دهی نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم انجام شد. در مورد مدت تماس و مقدار حلال مصرفی باید به این نکته توجه نمود که اگر زمان تماس و مقدار حلال کم باشد، سطح به اندازه کافی جهت پوشش‌دهی بوسیله نانو ذرات  $TiO_2$  آماده نمی‌شود و اگر زمان تماس و مقدار حلال زیاد باشد باعث تخریب رزین می‌شود. پس از عمل آماده‌سازی سطح رزین فرآیند تثبیت نانو ذرات  $TiO_2$  بر روی رزین انجام می‌شود. به منظور بررسی کیفیت فرآیند آماده‌سازی سطح رزین‌های پوشش داده شده از آنالیزهای مقاومت در برابر آب، DSC و SEM استفاده



شکل ۲: ساختار شیمیایی رنگرای اسیدی آبی ۹۲.

شده است.

مشخصات رزین پایه معدنی مورد استفاده

۱- رزین سیلیکون: ۷۵ درصد

۲- مونومر، حلال و سایر ترکیبات: ۲۵ درصد

۳- مقدار پلی سیلوکسان در رزین جامد: ۵۰ درصد

### ۳) نتایج و بحث

همان‌طور که در جدول (۲) مشاهده می‌شود مرحله آماده‌سازی رزین‌های پوششی توسط حلال‌های الکل، تولوئن، متیل اتیل کتون (MEK) و استون در مدت زمان‌های ۱۰، ۱۵ و ۲۰ دقیقه انجام شده است. بهترین نتیجه آماده‌سازی توسط حلال استون، در مدت زمان ۲۰ دقیقه صورت پذیرفت. همان‌طور که مشاهده می‌شود تنها حلال استون سطح رزین مورد استفاده جهت پوشش دهی کاتالیست را از طریق ایجاد تخلخل آماده‌سازی نموده است.

به‌منظور بررسی دوام رزین‌های پوششی آماده‌سازی شده، مقاومت فیلم‌های پوششی بوسیله دستگاه DSC در دمای ۵۰- تا ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نمودار بدست آمده از آزمایش DSC نشان می‌دهد که نمونه‌های پوششی آماده‌سازی شده در این آزمایش تغییرات کمی را دارد و فرآیند تخریب مشاهده نمی‌شود (اختلاف دما (Tg) نمودارهای DSC بسیار کم بوده که قابل صرف نظر است).

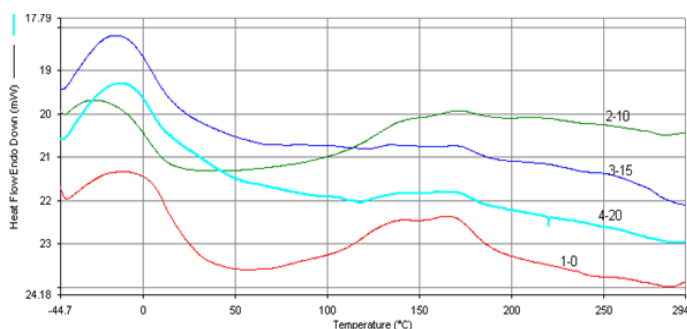
همان‌طور که در جدول (۳) مشاهده می‌شود در این آزمایش مقاومت

جدول ۱: مشخصات رنگزای اسیدی آبی ۹۲.

۱۳۳۹۰	عدد کالر ایندکس
$C_{27}H_{14}N_2S_7Na_8O_{11}$	فرمول مولکولی
۶۹۵٫۵۸ g/mol	وزن مولکولی
ciba	شرکت سازنده

جدول ۲: آماده‌سازی سطح رزین معدنی بوسیله حلال‌های مختلف در زمان‌های ۱۰، ۱۵ و ۲۰ دقیقه

زمان (min)	تولوئن	متیل اتیل کتون	استون	الکل
۱۰	بدون تغییر	بدون تغییر	بدون تغییر	بدون تغییر
۱۵	بدون تغییر	بدون تغییر	بدون تغییر	بدون تغییر
۲۰	بدون تغییر	پوسته پوسته	آماده‌سازی	بدون تغییر

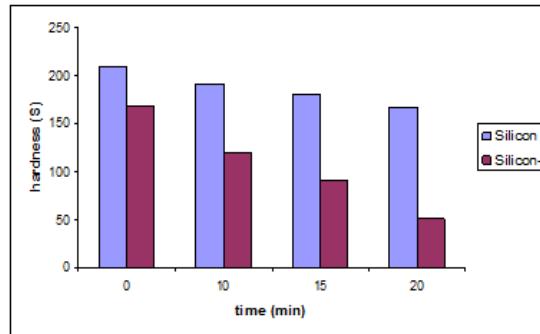


شکل ۳: نمودار DSC برای پوشش‌های رزینی اعمال شده در زمان‌های مجاورت با حلال در زمان صفر (۰-۱)، در مدت زمان ۱۰ دقیقه (۱-۲)، در مدت زمان ۱۵ دقیقه (۲-۳) و در مدت زمان ۲۰ دقیقه (۳-۴) دقیقه.

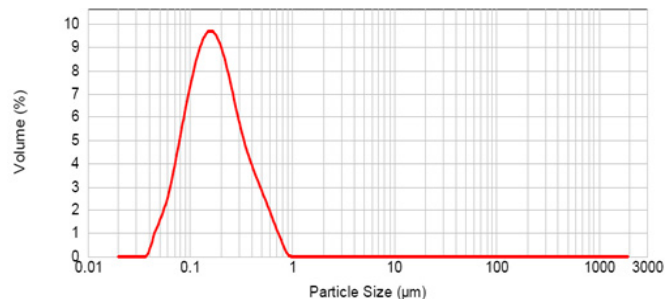


جدول ۳: آنالیز مقاومت فیلم‌های پوششی رزین معدنی آماده سازی شده در برابر آب در زمان‌های متفاوت

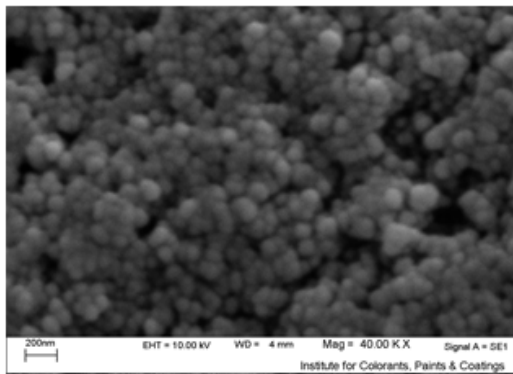
زمان (h)	پوسته پوسته شدن	تاول زدگی	ترک خوردگی	ورآمدن
۲۴	-	-	-	-
۴۸	-	-	-	-
۷۲	-	-	-	-



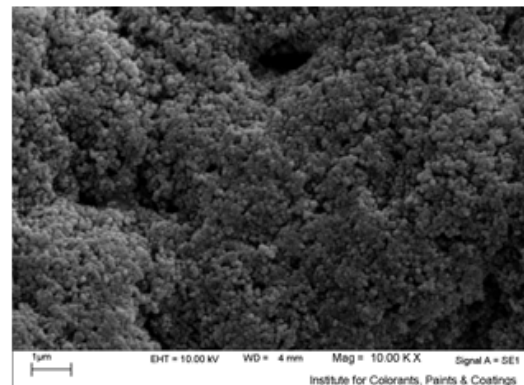
شکل ۴: نمودار سختی پوشش رزین سیلیکونی به صورت اعمال دستی و فیلم کش.



شکل ۵: نمودار PSA محلول دیسپرس شده نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم در حلال با حضور دیسپرس کننده.



شکل ۷: تصویر SEM از پوشش‌دهی نانو ذرات دی‌اکسیدتیتانیوم بر روی رزین معدنی.



شکل ۶: تصویر SEM از پوشش‌دهی نانو ذرات دی‌اکسیدتیتانیوم بر روی رزین معدنی.



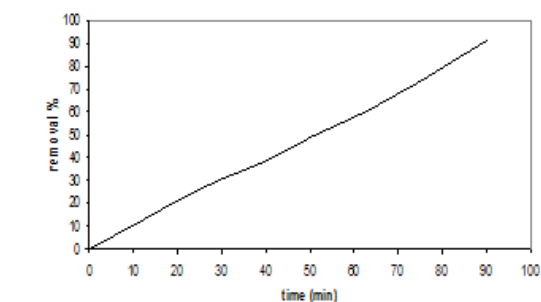
شکل ۸: تصویر معمولی پوشش‌دهی سطح با نانو ذرات دی‌اکسیدتیتانیوم بر روی رزین معدنی.

مشاهده می شود که نمودار حاصل تکه قله ای بوده که این نشان همگنی و یکنواختی محلول دیسپرس شده دارد. همان گونه که در شکل های (۶) و (۷) مشاهده می شود برای بررسی فرآیند تثبیت نانو ذرات  $TiO_2$  بر روی رزین پوششی (فرآیند تثبیت نانو فتوکاتالیست به روش عمقی بر روی سطح رزین آماده سازی شده صورت گرفته است)، تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) با مقیاس های  $1 \mu m$  و  $200 nm$ ، از سطح پوشش تهیه شده است که نحوه قرار گیری نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم را روی سطح رزین نشان می دهد و شکل (۸) تصویر معمولی از سطح پوشش ساخته شده را ارائه می دهد.

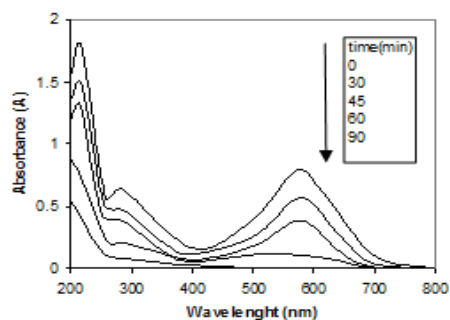
برای بررسی تأثیر رنگبری و معدنی شدن رنگزا توسط نانوذرات  $TiO_2$  پوشش داده شده بر روی رزین، ابتدا ۱۲۵ میلی لیتر از محلول رنگزا دارای غلظت ۵۰ ppm (به عنوان پساب شبیه سازی شده) را داخل راکتور ریخته و بعد به آن ۱۰ میلی لیتر آب اکسیژنه ppm ۳۰۰ اضافه نمودیم سپس لامپ فرابنفش و پمپ هوادهی را روشن کرده و عمل رنگبری در مدت زمان های ۳۰، ۴۵، ۶۰، ۹۰ دقیقه صورت می پذیرد، در این زمان ها از محلول نمونه گیری کرده و توسط دستگاه UV/vis طیف جذبی این نمونه ها را می گیریم. در نهایت با مقایسه طیف محلول رنگزا قبل از فرآیند رنگبری و بعد از فرآیند رنگبری مشاهده می کنیم که عمل رنگبری و معدنی نمودن، بخوبی انجام شده است. ضمناً باید اشاره کرد که فرآیند رنگبری در pH خنثی صورت گرفته است.

همانگونه که در شکل ۱۰ مشاهده می شود در مدت زمان ۹۰ دقیقه میزان درصد رنگبری (تخریب) رنگزای اسیدی آبی ۹۲ به بیش از ۹۰ درصد می رسد.

۴) نتیجه گیری  
در این تحقیق با توجه به نتایج حاصل از فرآیند آماده سازی سطح و آزمایشات مختلف همچون مقاومت در برابر آب، SEM و DSC بر روی پوشش های اعمال شده می توان به کیفیت میزان مقاومت



شکل ۱۰: درصد رنگبری (تخریب) رنگزای اسیدی آبی ۹۲ در مدت ۹۰ دقیقه.



شکل ۹: نمودار طیف UV/Vis رنگبری رنگزای اسیدی آبی ۹۲ در pH=7

## ۵ مراجع

- [1] M.A. Behnajady, N. Modirshahla, N. Daneshvar, and M. Rabbani, "Photocatalytic degradation of an azo dye in a tubular continuous-flow photoreactor with immobilized TiO<sub>2</sub> on glass plates", *Chemical Engineering Journal*, 127, 2007, 167-176.
- [2] Rabbani, M.; Bathaee, H.; Rahimi, R.; Maleki, A. *Desalination and Water Treatment* 2016, 57, 25848.
- [3] Fayyaz, F.; Rahimi, R.; Rassa, M.; Maleki, A. *Water Science & Technology: Water Supply* 2015, 15, 1099.
- [4] T. Sauer, G. Cesconeto Neto, H.J. Jose, and R.F.P.M. Moreira, "Kinetics of photocatalytic degradation of reactive dyes in a TiO<sub>2</sub> slurry reactor", *Journal of Photochemistry and photobiology A: chemistry*, 149, 2002, 147-154.
- [5] N. Daneshvar, D. Salari, and M.A. Behnajady, "Decomposition of anionic sodium dodecylbenzen sulfonate by UV/TiO<sub>2</sub> and UV/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Processes: a comparison of reaction rates", *Iran Journal of Chemistry and Chemical Engineering*, 21, 2002, 55-62
- [6] D.S. Bhatkande, V.G. Pangarkar, and A.A.C.M. Beenacker, "Photocatalytic degradation for environmental applications – a review", *Journal of Chemical Technology and Biotechnology*, 77, 2001, 102-116.
- [7] K. Badii, S.M. Hashemi, H. Ahmadi Moghadam, A.M. Araabi, S. Jebeli Moein, S. Abdolreza, F. Badii, "Surface Coating of Glass Reactors with Nano Titanium Dioxide for Propose of Advanced Oxidation Process of Organic Colorants in Aqueous Environments: Comparison between Surface Coatings by Polymeric Glues and Surface Preparation Methods", *International Catalysis Conference - ICC 2008, Shahid Beheshti University, 28-30 April 2008*, P111
- [8] N. Daneshvar, D. Salari, and A.R. Khataee, "Application of artificial neural networks for modeling of the treatment of wastewater contaminated with methyl tert-butyl ether (MTBE) by UV/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> process", *Journal of Photochemistry and photobiology A: chemistry*, 157, 2003, 111-116.
- [۹] رحیمی، ا.، ۱۳۸۳، سیلیکونها، انتشارات انجمن پلیمر ایران، تهران.
- [۱۰] مازندرانی، م.، ۱۳۷۵، تکنولوژی رنگ و رزین، جلد (۲ و ۱)
- [11] S. M. Hashemi, Kh. Badii, Sh. Abdolreza, "Stydy of Immobilization of Nano-TiO<sub>2</sub> for Environmental Aspects on Glass by Different Resin Families", *Journal of Progress in Color, Colorants and Coatings (PCCC)*, Institute for Color Science and Technology, Vol.4, No.1, 2011, 1-6

بررسی مقاومت پوشش‌های رزین معدنی نشان می‌دهد:  
 - فیلم‌های پوششی رزین معدنی آماده‌سازی شده در برابر آب در مدت زمان‌های ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت مقاومت خوبی در برابر عواملی (چون پوسته پوسته شدن، تاول زدگی، ترک خوردگی و ورآمدن) نشان می‌دهد.  
 - فیلم‌های پوششی آماده‌سازی شده بوسیله دستگاه سختی سنج کونینگ طبق استاندارد ASTM D2794 مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاکی از مقاومت فیلم‌های پوششی می‌باشد.  
 - نمودار بدست آمده DSC حاصل از نمونه‌های پوششی آماده‌سازی شده در این آزمایش تغییرات کمی را دارد و فرآیند تخریب بر روی نمونه‌ها صورت نمی‌گیرد.  
 - بررسی هر یک از این آزمایش‌ها نشان می‌دهد که هر دو فرآیند آماده‌سازی و تثبیت بخوبی صورت پذیرفته و فرآیند رنگبری نیز به طور موثری اتفاق افتاده است.